

code élément	lib long	libellé en anglais	responsable	nature	crédits	CNU	CM	TD	TP	Session 1						session 2 O/N	Session 2					
										C. Term			E. Comp				C. Term			E. Comp		
										Durée	Infos	%	Durée	infos	Durée		Infos	%	Durée	Infos	%	
VT3COMS	Commande des systèmes séquentiels	sequential control	D.Gendreau	UE	3	61	9	9	16				100%		oral/écrit	O	01:30	60%	40%		oral/écrit	
VT3IBW1	Electronique	Electronics		UE	6																	
VT3YCELE	Initiation aux techniques de conception électronique	Electronics design	I.Lajoie	ELC	3	63	9	8	12				100%		oral/écrit	O	01:30	60%	40%		oral/écrit	
VT3YELEF	Electronique fonction	Analog electronics	I.Lajoie	ELC	3	63	8	12	9				100%		oral/écrit	O	01:30	60%	40%		oral/écrit	
VT3IBW2	Fondamentaux pour les SPI 1	Fundamentals in Engineering	N.Kacem	UE	6																	
VT3YFING	Fondamentaux pour l'ingénieur	Fundamentals in Engineering 1	N.Kacem	ELC	3	60	18	12					100%		oral/écrit	O	01:30	80%	20%		oral/écrit	
VT3YSIOM	Outils mathématiques pour l'ingénieur 2	Engineering Mathematics 2	N.Kacem	ELC	3	60		15	15				100%		oral/écrit	O	01:30	100%	0%		oral/écrit	
VT3IBW3	Mécanique parcours EA et IMC	Mechanics	N.Bouhaddi	UE	6																	
VT3YMSYS	Mécanique des systèmes 1	Mechanical of systems 1	N.Bouhaddi	ELC	3	60	15	15					100%		oral/écrit	O	02:00	100%	0%		oral/écrit	
VT3YTNRJ	Transferts énergétiques	Energy transfer	E.Jacquet	ELC	3	60	12	15	6				100%		oral/écrit	O	01:30	67%	33%		oral/écrit	
VT3IBW4	Physique	Physics		UE	6																	
VT3YEMST	Electrostatique et magnétostatique	Steady state electromagnetic fields	F.Devaux	ELC	3	30	11	18				40%	60%		oral/écrit	O	01:30	60%	40%		oral/écrit	
VT3YOPTO	Introduction optoélectronique	Introduction to optoelectronics	F.Chollet	ELC	3	63	8	12	9				100%		oral/écrit	O	01:30	60%	40%		oral/écrit	
VT3IBLA	Anglais	English 2	V.Renault	UT	3	TAN		18					100%		oral/écrit	O		100%	0%		oral/écrit	
VT3CRE	Concevoir et réaliser	Design and Implementation	L.Guyout	UE	6	60	14	14	30				100%	01:30	oral/écrit	O	01:30	75%	25%	01:30	oral/écrit	
VT3INDUS	Industrialisation et technologie	Applied Design and Manufacturing	B.Gaume	UE	6	60	19	33	6				100%	03:00	oral/écrit	O	03:00	100%	0%		oral/écrit	
VT3IBW5	Mécanique parcours GM	Mechanics	N.Bouhaddi	UE	6																	
VT3YCREA	Créativité et prototypage	Creativity and Prototyping	L.Guyout	ELC	3	60	12	15	6				100%	01:30	oral/écrit	O	01:30	75%	25%	01:30	oral/écrit	
VT3PCMAT	Physico-chimie des matériaux	The physical chemistry of materials	E.Jacquet	UE	3	60	12	6	9				100%		oral/écrit	O	01:30	50%	50%		oral/écrit	
VT4IBLAS	Anglais pour l'ingénieur	Technical english	F.Chollet	UE	3	63		18					100%		oral/écrit	O	01:30	60%	40%		oral/écrit	
VT4YDIM1	Dimensionnement des structures 1	strength of materials 1	C.Berriet	ELC	3	60	12	9	8				100%	01:30	oral/écrit	O	01:30	80%	20%		oral/écrit	
VT4IBW1	Electronique et automatique	Electronic and automatic	E.Carry	UE	6																	
VT4YCOS1	Commande des systèmes continus 1 - Méthodes temporelles	Automatic control	A.Mohand Ousaid	ELC	3	61	12	9	8				100%		oral/écrit	O	01:30	100%	0%		oral/écrit	
VT4YPROG	Programmation électronique	Electronic programming	E.Carry	ELC	3	63	3	3	22				100%		oral/écrit	O	02:00	60%	40%		oral/écrit	
VT4IBTEX	Expression et communication - APP	Communication techniques		UT	3	TOU		18					100%		oral/écrit	N						
VT4IBW2	Fondamentaux pour les SPI 2	Fundamentals in Engineering 2	J.Lardiès	UE	6																	
VT4YIBOM	Outils mathématiques pour l'ingénieur 3	Engineering Mathematics 3	J.Lardiès	ELC	3	60		15	15				100%		oral/écrit	O	01:30	100%	0%		oral/écrit	
VT4YIBPS	Probabilités/Statistiques	Probabilities and statistics	E.Lantz	ELC	3	63	12	9	9				100%		oral/écrit	O	01:30	60%	40%		oral/écrit	
VT4IBW3	Mesures parcours EA et IMC	Measurement	T. Leblois	UE	6																	
VT4YMEA	Mesures en EA	Sensor and electronic measurements	T. Leblois	ELC	3	63	9	12	9				100%		oral/écrit	O	01:30	60%	40%		oral/écrit	
VT4YMME	Mesures en mécanique	Measurement and Data Acquisition in Mechanics	V.Walter	ELC	3	60	12	9	9				100%		oral/écrit	O	02:00	60%	40%		oral/écrit	
VT4PSEM	Physique des semiconducteurs	Semiconductor physics	R.Giust	UE	3	30	14	12	3				100%		oral/écrit	O	02:00	60%	40%		oral/écrit	
VT4IBW4	Dimensionnement des structures	strength of material	C.Berriet	UE	6																	
VT4YDIM2	Dimensionnement des structures 2	strength of materials 2	C.Berriet	ELC	3	60	15	12	4				100%	01:30	oral/écrit	O	01:30	80%	20%		oral/écrit	
VT4IBW5	Matériaux	Materials	E.Jacquet	UE	6																	
VT4YCVIE	Matériaux cycle de vie	Materials life cycle	E.Jacquet	ELC	3	60	12	9	12				100%		oral/écrit	O	01:30	80%	20%		oral/écrit	
VT4YCMAT	Outils pour le choix des matériaux	Choice of materials	E.Jacquet	ELC	3	60	15	9	12				100%		oral/écrit	O	01:30	80%	20%		oral/écrit	
VT4IBW6	Mesures parcours GM		T. Leblois	UE	6																	
VT4YMET	Métrologie	Metrology	G.Dupuis	ELC	3	60	9	12	9				100%	01:30	oral/écrit	O	01:30	75%	25%	01:30	oral/écrit	